日本国特許庁

特許協力条約に基づいて国際公開された日本語特許出願

出願番号 特願平 1-504942

(平成2年4月5日発行)

Int.Cl.5 識別記号 G 02 B 1/04

> 部門(区分) 6(2) 答 査 請 求 未請求 未請求 予備審査請求

(1)) 国際公開番号 ΑI

WO 89/10575

(43) 国際公開日

(81) 指定国

1989年11月2日(02.11.89)

(21) 國際出願香号 (22) 國際出顧日 PCT/JP89/00454 1989年5月1日 (01. 05. 89) (30) 優先権データ 特質培63-10546**6** 1988年4月30日(30.04.88) (71) 出願人(米図を除くすべての指定図について) J.P 三并某些化学模式会社 (MITSUI TOATSU CHENICALS, INCORPORATED)(JP/JP) 〒100 東京都テ代巴区在沙漠三丁目 2 着 5 号 Tokyo, (JP) (72) 発明者;および

A.T(欧州海許),A.U., B.E(欧州海芹),B.R. C.H(欧州海芹), 添付公開答題

DE(欧州等幹),FR(欧州等阵),GB(欧州等群),IT(欧州等群)。 JP, KR, LU(欧州特特), NL(欧州特特), SE(欧州特特),

(75)発明者/出願人(米回についてのみ)

会村矛盾 (KANEMURA, Yoshinobu)[JP/JP]

〒 244 神泉川県横浜市県区収島町 2882 Kanagawa, (JP) 空川島舟 (SASAGAWA, Kalsuyoshi)(JP/JP)

〒223 汗京川県博興市港北区新世田町1510 Kanagawa, (JP) 今并建六 (IMAI, Masao)(JP/JP) (74) 代禮人

弁理士 石井 阜 (WAKABAYASHI, Tadashi) 〒107 東京都港区赤坂1丁目9巻20号 第16異和ビル6簿 Tokyo, (JP)

(54) Title: HIGH REFRACTIVE INDEX LENS AND METHOD FOR ITS PRODUCTION

高座折率レンズおよびその製造法

(57) Abstract

This invention relates to a polysulfide resin lens and a method of its production comprising cast polymerisation of a mix-This invention relates to a polysulfide resin lens and a method of its production comprising cast polymerisation of a mix-ture of an epoxy/episulfide resin having at least two epoxy groups and/or episulfide groups in one molecule, at least bifunctional polythiol and an internal mold releasing agent. The present invention provides a lens having excellent optical characteristics and

この公表に係る日本語特許出願(日本語奥用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10 』 こいながたは、ロチョウ町四駅(ロチョス内割米豆짜山駅)の回ば五時の別水は、竹町広第 184 年 第1項(実用新案法第 48 条の 13 第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係がありません。

(57) 要約.

本発明は、一分子中に二個以上のエポキシ基および/またはエピスルフィド基を有するエポキシ/エピスルフィド樹脂と二官能以上のポリチオールと内部離型剤の混合物を注型重合することにより得られるポリスルフィド系樹脂製レンズおよびその製造法であり、良好な光学物性と高い面精度を有するレンズを提供するものである。

明 細 **書** 高屈折率レンズおよびその製造法

技術分野

本発明はポリスルフィド系樹脂製レンズ及びその製造方法に関する。さらに詳しくは、一分子中に2個以上のエポキシ基および/またはエピスルフィド基を有するエポキシ/エピスルフィド樹脂(以下、エポキシ樹脂と称する)と、2官能以上のポリチオールと内部離型剤の混合物を注型重合して得られるポリスルフィド系樹脂製レンズおよびその製造方法に関するものである。

プラスチックレンズは、無機レンズに比べて軽量で 割れにくく、染色が可能なため、近年、眼鏡レンズ、 カメラレンズ等の光学素子に急遠に普及してきてい る。

背景技術

これらの目的に現在広く用いられている樹脂としては、ジェチレングリコールピス(アリルカーボネート)(以下、D.A.C.と称す)をラジカル重合させたものがある。この樹脂は、耐衝撃性に優れていること、軽量であること、染色性に優れていること、切削性および研磨性等の加工性が良好であることなどの種々の特徴を有している。

れるが、DAC等熱硬化性樹脂を素材とする場合には、注型成型法が用いられる。この場合、レンズのモールド型の難型性が重要であり、離型が早すぎるとレンズの表面が乱れたり、歪みが生じやすく、逆に離型が困難になるとモールド型の剝離が起こる。 解型がとしてDACにリン酸ブチルを用いることが知られているが、通常はレンズの物性上、内部離型剤は用いないのが好ましいとされている。(美馬精一、ポリマーダイジェスト、3、39(1984)等)

しかし、一般にエポキシ樹脂系レンズ注型時は、レンズとモールドとの密着性が良く、通常、レンズとモールドの離型は困難である。

前述の公知のエポキシ樹脂によるレンズは、DACを用いたレンズよりも屈折率は向上するものの、まだ、不充分であったり、また、屈折率を向上させるために、分子内に多数のハロゲン原子或いは、芳香環を有する化合物を用いているために、分散が大きい、耐候性が悪い、あるいは比重が大きいといった欠点を有している。

一方、本出願人は、エポキシ樹脂系レンズ注型時の 離型性改良法としてモールドを外部離型剤で処理する 方法やポリオレフィン樹脂製モールドを使用する方法 を試みた。

しかしながら、モールドにフッ素やシリコン系外部

しかしながら、屈折率が無機レンズ(n。 = 1.52) に比べn。 = 1.50と小さく、ガラスレンズと同等の光 学特性を得るためには、レンズの中心厚、コパ厚、お よび曲率を大きくする必要があり、全体的に肉厚にな ることが避けられない。この為、より屈折率の高いレ ンズ用樹脂が望まれている。

しかし、エポキシ樹脂をポリチオールで硬化させて レンズを得る技術は知られていなかった。

一方、プラスチックレンズは高度な面精度、光学登み計で歪みが発見されない程の光学的均質性、高度な透明性を要求される気泡の全くない剛体である。

一般に、プラスチックレンズの加工方法として、切 削研磨、熱プレス成形、注型成型、射出成型が用いら

このような状況に鑑み、本発明者らは、エボキシ街間と2官能以上のボリチオールと内部離型が上の説明を注型重合して得られるボリスルフィド系樹脂製ンズが、優れた光学物性と、一般に使用されるガリスとで見出してモールドを使用してモールド表面の特別な難型処理を一つに高度な面積度と優れた透明性を有するレンズを工業的にも極めて効率よく製造しうることを見出し、本発明に到達した。

発明の開示

即ち、本発明は、一分子中に2個以上のエポキシ 書および / またはエピスルフィド 基を有するエポキシ樹脂と、2 官能以上のポリチオールと内部 離型剤の混合物を注型重合して得られるポリスルフィド系樹脂製レンズおよびその製造方法に関する。

発明を実施するための最良の形態

本発明のエポキシ樹脂としては、たとえば次のようなものが挙げられる。

(i) アミン系エポキシ樹脂

N - C H - C H - C H - 基を有するエポキシ樹

脂で、例えば、N.N.N'.N' ーテトラグリシジルジアミノフェニルメタン、メターN.N ージグリシジルアミノフェニルグリシジルエーテル、N.N.N'.N' ーテトラグリシジルテレフタルアミドなどのような、アミノ基やアミド基を有する化合物と、エピクロルヒドリン、メチルエピクロルヒドリン、エピブロムヒドリンなどのエピハロヒドリンとから合成される樹脂。

アミノ基を有する化合物の具体例としては、ジアミノジフェニルメタン、メタキシリレンジアミン、バラキシリレンジアミン、メタアミノベンジルアミン、バラアミノベンジルアミン、 1.3-ピスアミノメチルシクロヘキサン、 1.3-ジアミノシクロヘキサン、 1.4-ジアミノ

フェノール系化合物の具体例としては、ハイドロキノン、カテコール、レゾルシン、ピスフェノールA、ピスフェノールF、ピスフェノールスルホン、 臭素化ピスフェノールA、ノボラック樹脂、 クレゾールノボラック樹脂、 テトラフェニルエタン、トリフェニルエタンなどが挙げられる。

(iii) アルコール系エポキシ樹脂

トリメチロールプロバントリグリシジルエーテル、ネオベンチルグリコールジグリシジルエーテルなどのように、アルコール系化合物とエピハロヒドリンから合成することができる樹脂である。

シクロヘキサン、メタフェニレンジアミン、パラフェニレンジアミン、ベンジルアミン、ダアミノジフェニルスルホン、ジアミノジフェニルエーテル、ジアミノジフェニルケトン、ナフタレンジアミン、アニリン、トルイジン、メタアミノフェノール、パラアミノフェノール、アミノナフトールなどが挙げられる。

またアミド基を有する化合物の具体例としては、フタルアミド、イソフタルアミド、テレフタルアミド、 ペンズアミド、トルアミド、パラヒドロキシベンズ アミド、メタヒドロキシベンズアミなどが挙げられる。

これらのアミノ基またはアミド基を有する化合物において、アミノ基又はアミド基以外のヒドロキシル基、カルボキシル基、メルカプト基などのエピハロヒドリンと反応する基を有する場合、これらのエピハロヒドリンと反応する基の一部または全部がエピハロヒドリンと反応し、エボキシ樹脂で置換されていてもよい。

(ii)フェノール系エポキシ樹脂

このタイプの樹脂は、ピスフェノールA ジグリシジルエーテル、エポトート YDCN-220 (東都化成株式会社の商品)などのように、フェノール系化合物とエピハロヒドリンから合成することができる。

、コールと多価カルボン設から作られるポリエステルポ リオールなどが挙げられる。

(iv)不飽和化合物のエポキシ化物

シクロベンタジエンエポキシド、エポキシ化大豆油、エポキシ化ポリブタジエン、ピニルシクロヘキセンエポキシド、ユニオンカーバイト社の商品名 ERL-4221、 ERL-4234、 ERL-4299などで知られる不飽和化合物のエポキシ化物などが挙げられる。

(v) グリシジルエステル系エポキシ樹脂

テトラヒドロフタル酸ジグリシジルエステルなどの ように、カルボン酸とエピハロヒドリンから合成する ことができる樹脂。

カルボン酸の具体例としては、アジピン酸、セバチン酸、ドデカンジカルボン酸、ダイマー酸、フタル酸、イソフタル酸、テトラヒドロフタル酸、スキサヒドロフタル酸、メチルテトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、ヘット酸、ナジック酸、マレイン酸、フマール酸、トリメリット酸、ベンゼンテトラカルボン酸、ブタンテトラカルボン酸、ベンソフェノンテトラカルボン酸、5-(2.5-ジオキソテトラヒドロフリル)-3-メチルーシクロヘキセン-1.2 - ジカルボン酸などの多価カルボン酸が挙げられる。

(vi)ウレタン系エポキシ樹脂

(iii) で挙げた多価アルコールとジイソシアナート

およびグリシドールとから合成することができる。

ジイソシアナートの具体例としてはトリレンジイソシアナート、ジフェニルメタンー4.4'ージイソシアナート、ヘキサメチレンジイソシアナート、イソホロンジイソシアナート、キシリレンジイソシアナート、ナフタレンジイソシアナートなどが挙げられる。

(vii) 脂環型エポキシ樹脂

3.4 - エポキシシクロヘキシル-3.4 - エポキシシクロヘキサンカルポキシレート、ビニルシクロヘキセンジオキサイド、2-(3.4 - エポキシシクロヘキシル-5.5 - スピロ-3.4 - エポキシ)ジクロヘキサンーメタージオキサン、ビス(3.4 - エポキシシクロヘキシル)アジベートなどの脂類型エポキシ樹脂などが挙げられる。

(Vili) その他のエポキシ樹脂

トリスエポキシプロピルイソシアヌレート、グリシシル(メタ)アクリレート共登合体、さらに前記したエポキシ樹脂のジイソシアナート、ジカルポン酸、多価フェノールなどによる変性樹脂などが挙げられる。

さらに(i) ~ (vlii)のエポキシ樹脂のエポキシ基の一部又は全部をエピスルフィド基に変換したエポキシ樹脂が挙げられる。

これらは、それぞれ単独で用いることも、また二種

ト)、エチレングリコールピス(3-メルカプトプロピ オネート)、トリメテロールプロパンピス(2-メルカ プトアセテート)、トリメチロールプロパンピス(3-メルカプトプロピオネート)、ペンタエリスリトール テトラキス(2-メルカプトアセテート)、ベンタエリ スリトールテトラキス(3-メルカプトプロピオネー ト)などの脂肪族ポリチオールおよびそれらの塩素置 換体、臭素置換体等のハロゲン置換化合物、1.2 - ジ メルカプトベンゼン、1.3 -シメルカプトベンゼン、 1.4 - ジメルカプトベンゼン、1.2 - ピス(メルカブ トメチル) ベンゼン、1.3 - ピス (メルカプトメチ ル) ベンゼン、1.4 - ピス (メルカプトメチル) ベン ゼン、1.2 - ビス(メルカプトエテル)ベンゼン、 1.3 - ヒス(メルカプトエチル)ベンゼン、1.4 - ヒ ス(メルカプトエチル)ベンゼン、1,2 - ピス(メル カプトメチレンオキシ) ベンゼン、1,3 -ビス (メル カプトメチレンオキシ) ベンゼン、1.4 - ビス (メル カプトメチレンオキシ) ベンゼン、1,2 - ピス (メル カプトエチレンオキシ) ベンゼン、1.3 - ピス (メル カプトエチレンオキシ) ベンゼン、1.4 - ピス (メル カプトエチレンオキシ) ベンゼン、1,2,3 ートリメル カプトペンゼン、1.2.4 -トリメルカプトペンゼン、 1,3,5 - トリメルカプトペンゼン、1,2,3 - トリス (メルカプトメチル) ベンゼン、1,2,4 ートリス (メ

以上を混合して用いてもよい。

また2官能以上のポリチオールとしては、例えば、 メタンジチオール、1.2 - エタンジチオール、1.1 -プロパンジチオール、1.2 - プロパンジチオール、 1,3 -プロパンシチオール、2,2 -プロパンジデオー ル、1.6 - ヘキサンジチオール、1.2.3 - プロバント リチオール、1.1 -シクロヘキサンジチオール、1.2 - シクロヘキサンジチオール、2,2 - ジメチルプロパ ンー1.3 - ジチオール、3.4 - ジメトキシブタンー 1.2 - ジチオール、2-メチルシクロヘキサン - 2.3 -ジチオール、ビシクロ (2,2,1)-ヘプターexo - cis - 2.3 - ジチオール、1.1 - ヒス (メルカプトメチ ル) シクロヘキサン、チオリンゴ酸ピス (2-メルカア トエチル)、2.3 -ジメルカプトコハク酸(2-メルカ プトエテルエステル)、2.3 - ジメルカプト-1-プロ パノール(2-メルカプトアセテート)、2.3 -ジメル カプトー1-プロパノール(3-メルカプトプロピオネー・ ト)、ジエチレングリコールビス(2-メルカプトアセ テート)、ジエチレングリコールピズ(3-メルカプト プロピオネート)、1.2 - シメルカプトプロピルメチ ルエーテル、2.3 - ジメルカプトプロピルメチルエー テル、2.2 - ピス(メルカプトメチル) - 1.3 - プロ パンジチオール、ピス(2-メルカプトエチル)エーテ ル、エチレングリコールピス(2-メルカプトアセテー

ルカプトメチル) ベンゼン、1.3.5 -トリス (メルカ プトメチル) ベンゼン、1.2.3 ートリス (メルカプト エチル) ベンゼン、1,2,4 ートリス (メルカプトエチ ル) ベンゼン、1.3.5 -トリス(メルカプトエチル) ベンゼン、1,2,3 -トリス(メルカプトメテレンオキ シ) ベンゼン、1.2.4 -トリス (メルカプトメチレン オキシ) ベンゼン、1.3.5 -トリス (メルカプトメチ レンオキシ) ベンゼン、1,2,3 ートリス (メルカプト エチレンオキシ) ベンゼン、1,2,4 ートリス (メルカ プトエチレンオキシ) ベンゼン、1.3.5 -トリス (メ ルカプトエチレンオキシ) ベンゼン、1,2,3,4 -テト ラメルカプトベンゼン、1.2.3.5 -テトラメルカプト ペンゼン、1.2.4.5 -テトラメルカプトペンゼン、 1.2.3.4 -テトラキス (メルカプトメチル) ベンゼ ン、1,2,3,5 ーテトラキス(メルカプトメテル)ベン ゼン、1.2,4,5 -テトラキス (メルカプトメチル) ベ ンゼン、1.2.3.4 - テトラキス (メルカプトエチル) ベンゼン、1,2,3,5 -テトラキス(メルカプトエチ ル) ベンゼン、1.2.4.5 -テトラキス (メルカプトエ チル) ベンゼン、1.2.3.4 -テトラキス (メルカプト メチレンオキシ)ベンゼン、1.2.3.5 -テトラキス (メルカプトメチレンオギシ) ベンゼン、1.2.4.5 -テトラキス (メルカプトメテレンオキシ) ベンゼン、 1,2,3,4 -テトラキス (メルカプトエチレンオキシ)

ベンゼン、1.2.3.5 -テトラキス (メルカプトエチレ ンオキシ) ベンゼン、1,2,4,5 -テトラキス (メルカ プトエチレンオキシ) ベンゼン、2.2'-ジメルカプト ピフェニル、4,4'ーシメルカプトピフェニル、4.4'ー ジメルカプトピベンジル、2,5 -トルエンジチオー ル、3.4 -トルエンジチオール、1.4 -ナフタレンジ チオール、1.5 ーナフタレンジチオール、2.6 ーナフ タレンジチオール、2.1 -ナフタレンジチオール、 2.4 - ジメチルベンゼン-1.3 - ジチオール、4.5 -ジメチルベンゼン-1.3 -ジチオール、9.10-アント ラセンジメタンチオール、1.3 - ジ (p-メトキシフェ ニル) プロパンー2.2 ージチオール、1.3 ージフェニ ルプロバン-2.2 -シチオール、フェニルメタン-1.1 ‐ラチオール、2.4 ‐ジ(p‐メルカプトフェニ ル) ペンタンなどの芳香族ポリチオール、また2.5 -ジクロロベンゼン-1.3 -ジチオール、1.3 -ジ (p-クロロフェニル) プロパン-2.2 -ジチオール、 3.4.5 ートリプロムー1.2 ージメルカプトベンゼン、 2.3.4.6 ーテトラクロルー1.5 ーピス (メルカプトメ チル)ベンゼンなどの塩素置換体、臭素置換体などの ハロゲン置換芳香族ポリチオール、また、2-メチルア ミノー4.6 - ジチオールー sym ートリアジン、2-エチ ルアミノー4.6 - ジチオール- sym - トリアジン、 2-アミノー4.6 - ジチオール - sym ートリアジン、

- テトラキス(メルカプトメチルチオ)ベンゼン、 1.2,4,5 -テトラキス(メルカプトメチルチオ)ベン ゼン、1.2,3,4 -テトラキス(メルカプトエチルチ オ) ベンゼン、1.2.3.5 -テトラキス (メルカプトエ チルチオ) ベンゼン、1.2.4.5 ーテトラキス (メルカ プトエチルチオ)ベンゼンなど、およびこれらの核ア ルキル化合物などの芳香族ポリチオール、ピス(メル カプトメチル) スルフィド、ピス (メルカプトエチ ル) スルフィド、ピス (メルカプトプロピル) スル フィド、ピス(メルカプトメチルチオ)メタン、ピス (メルカプトエチルチオ) メタン、ピス (3-メ・ルカプ トプロピル) メタン、1.2 -ヒス(メルカプトメチル チオ) エタン、1.2 ~ ピス (2-メルカプトエテルチオ) エタン、1.2 -ヒス(3-メルカプトプロピルチオ) エタン、1.3 ーピス(メルカプトメチルチオ)プロパ ン、1.3 - ビス(2-メルカプトエチルチオ)プロバ ン、1.3 ~ビス(3-メルカプトプロピルチオ)プロバ ン、1,2,3 -トリス(メルカプトメチルチオ)プロパ ン、1.2.3 -トリス(2-メルカプトエチルチオ)プロ パン、1.2.3 ートリス(3-メルカプトプロビルチオ) プロバン、テトラキス(メルカプトメチルチオメチ ル) メタン、テトラキス(2-メルカプトエチルチオメ チル) メタン、テトラキス(3-メルカプトプロピルチ オメチル) メタン、ピス(2.3 -ジメルカプトプロピ

2-モルホリン-4.6 ージチオールーsym ートリアジン、2-シクロヘキシルアミノー4.6 ージチオールーsym ートリアジン、2-メトキシー4.6 ージチオールーsym ートリアジン、2-フェノキシー4.6 ージチオールーsym ートリアジン、2-チオベンゼンオキシー4.6 ージチオールーsym ートリアジン、2-チオブチルオキシー4.6 ージチオールーsym ートリアジンなどの複素で換体、含有したポリチオールおよびそれらの塩素で換体、臭素で複体などハロゲンで換化合物。

1.2 - ビス (メルカプトメチルチオ) ベンゼン、
1.3 - ビス (メルカプトメチルチオ) ベンゼン、1.4 - ビス (メルカプトメチルチオ) ベンゼン、1.2 - ビス (メルカプトエチルチオ) ベンゼン、1.4 - ビス (メルカプトエチルチオ) ベンゼン、1.4 - ビス (メルカプトエチルチオ) ベンゼン、1.2.3 - トリス (メルカプトメチルチオ) ベンゼン、1.2.4 - トリス (メルカプトメチルチオ) ベンゼン、1.2.3 - トリス (メルカプトメチルチオ) ベンゼン、1.2.3 - トリス (メルカプトエチルチオ) ベンゼン、1.2.4 - トリス (メルカプトエチルチオ) ベンゼン、1.2.4 - トリス (メルカプトエチルチオ) ベンゼン、1.2.3.4 - テトラキス (メルカプトメチルチオ) ベンゼン、1.2.3.5

ル) スルフィド、2.5 -シメルカプト-1.4 -シテア ン、ピス(メルカプトメチル)シスルフィド、ピス (メルカプトエチル) シスルフィド、 ピス (メルカブ トプロピル) シスルフィドなど、およびこれらのチオ グリコール酸およびメルカプトプロピオン酸のエステ ル、ヒドロキシメチルスルイドビス (2-メルカフトア セテート)、ヒドロキシメチルスルイドピス (3-メル カプトプロピオネート)、ヒドロキシエチルスルフィ ドビス(2-メルカプトアセテート)、ヒドロキシエチ ルスルフィドピス (3-メルカプトプロピオネート)、 ヒドロキシブロビルスルフィドビス (2-メルカプトア セテート)、ヒドロキシプロピルスルフィドピス (3-メルカブトプロピオネート)、ヒドロキシメチルシス ルフィドピス(2-メルカプトアセテート)、ヒドロキ シメチルジスルフィドビス (3-メルカプトプロビオ ネート)、ヒドロキシエチルジスルフィドピス(2-メ ルカプトアセテート)、ヒドロキシエチルジスルフィ ドビス(3-メルカプトプロピオネート)、ヒドロキシ プロピルシスルフィドビス(2-メルカプトアセテー ト)、ヒドロキシプロビルジスルフィドビス(3-メル カプトプロピオネート)、2-メルカプトエチルチォ エーテルビス(2-メルカプトアセテート)、2-メルカ プトエチルチオエーテルピス(3-メルカプトプロピォ ネート)、1.4 ージチアンー2.5 ージオールピス(2-

メルカプトアセテート)、1.4 -ジチアンー2.5 -ジ オールピス(3-メルカプトプロピオネート)、チオジ グリコール酸ピス(2-メルカプトエチルエステル)、 チオジプロピオン酸ピス(2-メルカプトエチルエステ ル)、4.4 -チオジプチル酸ピス(2-メルカプトエテ ルエステル)、ジチオジグリコール酸ヒス (2-メルカ プトエチルエステル)、ジチオジプロピオン酸ピス (2-メルカプトエチルエステル)、4.4 - ジチオジブ チル酸ピス(2-メルカプトエチルエステル)、チオジ グリコール酸ピス(2.3 -ジメルカプトプロピルエス テル)、チオジプロピオン酸ピス(2.3 -ジメルカブ トプロピルエステル)、ジチオグリコール酸ビス (2.3 - シメルカプトプロピルエステル)、ジチオジ プロピオンピス(2.3 - ジメルカブトプロピルエステ ル)などの脂肪族ポリチオール、3.4 -チオフェンジ チオール、ビスムチオール、2.5 - ジメルカプト-1.3.4 -チアジアソールなどの複素環化合物などが挙 げられる.

さらにはこれらの塩素置換体、具素置換体などのハロゲン置換体を使用してもよい。

これらは、それぞれ単独で用いることも、又二種以 上を混合して用いてもよい。

これら一分子中に2個以上のエポキシ基および/またはエピスルフィド甚を有するエポキシ樹脂と2官能

カチオン型界面活性剤はアルキル第4級アンモニウム塩であり、アルキル第4級アンモニウムのハロライドは、リン酸塩、硫酸塩である。具体的にはクロライドの形で示すと、トリメチルセチルアンモニウムクロライド、シメチルエチルセチルアンモニウムクロライド、トリエチルドデシルアンモニウムクロライド、シエチルシクロストルドデシルアンモニウムクロライドなどが挙げられる。

非イオン界面活性剤は、ポリオキシアルキル脂肪酸エステル、ポリオキシアルキルエーテル、ジメチルポリシロキサン基を有し、かつヒドロキシアルキル基又はリン酸エステル基を有するシリコン系化合物やパーフルオロアルキル基を有するフッ素系化合物である。具体的にはシリコン系化合物としては、米国ダウケミカル社のQ2-120Aがフッ素系化合物としては、

ユニダインDS-401 (ダイキン工業株式会社製) ユニダインDS-403 (ダイキン工業株式会社製) エフトップEF-122A (新秋田化成株式会社製) エフトップEF-126 (新秋田化成株式会社製)

エフトップ E.F.-301 (新秋田化成株式会社製)

本発明において用いられる内部鍵型剤は、界面活性 剤、ワックス類、有機シリコン化合物、有機フッ素 化合物があるが、好ましくは、界面活性剤が使用される。

本発明において用いられる界面活性剤は、イオン型 界面活性剤、非イオン型界面活性剤に大別つれイオン 型界面活性剤は、アニオン型界面活性剤、カチオン型 界面活性剤に分類される。アニオン型界面活性剤は、 硫酸エステル系、スルホン酸エステル系、リン酸エス テル系があげられるが、この中でリン酸エステル系界 面活性剤が好ましく、特に酸性リン酸エステル系アニ オン界面活性剤が好きしい。酸性リン酸エステル系ア ニオン界面活性剤として、具体的には、イソプロピル アシッドホスヘート、ジイソプロピルアシッドホス ヘート、ブチルアシッドホスヘート、ジブチルアシッ ドホスヘート、オクチルアシッドホスヘート、ジオク チルアシッドホスヘート、イソデシルアシッドホス ヘート、ジイソデシルアシッドホスヘート、ドデカ ノールアシッドホスヘート、ピス(トリデカノール) アシッドホスペートが挙げられる。

が挙げられる。

これら内部鯉型剤は、単独で使用してもよく、2種以上とを混合して使用してもよい。これらはモノマー組合せ、 重合条件、 経済性、 取り扱いの容易さより 通直選ばれる。内部離型剤の使用量は単独または2種以上の混合物としてエボキシ樹脂とポリチオールの合計重量に対して 1~10000ppmの範囲であり、 添加量が1 ppm 未満であると離型能が極端に悪化し、 10000ppmを超えると注型重合中にモールドから離型が起こってしまいレンズ数面の面積度が悪化するばかりでなく得られるレンズが白濁し好ましくない。

本発明の硬化促造触媒としては、エポキシ樹脂用として公知のものが使用できる。例えば、第三級アミン、第三級アミン塩、第四級アンモニウム塩、金属塩、各種イミダゾール類である。

さらに、目的に応じて光安定剤、紫外線吸収剤、酸 化防止剤、油溶染料、充塡剤などの種々の物質を添加 してもよい。

本発明のレンズは、注型重合により得られる。

具体的には、エボキシ樹脂と2官能以上のポリチオールと内部離型剤を混合する。必要に応じて触媒その他添加剤を加え、充分に脱泡した後、均一になったモノマー添加剤混合物をモールド型中に注入し、重合させる。モールド型は、樹脂製ガスケットに金属製又

はガラス製モールドを組み合わせて作るが、モールド 材質としては、操作性、生意性の面から、ガラスが好 ましい。

重合温度及び重合時間は、モノマーの種類、離型剤、触媒等の添加剤、レンズの形状、厚みにより適宜決められるが、一般にはレンズ中に実質的に光学壺が発生しない程度の低温で重合硬化させる。さらに重合後、離型を容易にするために硬化温度以上、好ましくは 100℃以上の温度に加熱しても良い。

このようにして得られる本発明のポリスルフィド樹脂製レンズは、高い面精度と優れた光学物性を有し、軽量で耐衝撃性に優れ、眼鏡レンズ、カメラレンズとして使用するのに好適である。

また、本発明のレンズは、必要に応じ、反射防止、高高度付与、あるいはファッション性付与等の改良を行なうため、表面研磨、帯電防止処理、ハードコード処理、無反射コート処理、染色処理、調光処理等の物理的あるいは化学的処理を施すことができる。

(実施例および比較例)

以下、本発明を実施例および比較例により具体的に 説明する。尚、得られたレンズ用樹脂の性能試験のう ち、屈折率、アッベ数、耐候性は以下の試験法により 測定した。

屈折率、アッベ数:プルリッヒ屈折計を用い、20℃

良好な面精度を有していた。

実施例2~12、比較例1~2

実施例1と同様にして、衰 - 1.の組成でレンズ化を 行なった。

性能試験の結果を表-1に示した。

比較例3~10

実施例1と同様にして下記の条件のモールドを用い、内部離型剤を用いずに衰-2の組成でレンズ化を行なった。結果を衰-2に示した。

モールド条件

- (1) 未処理 ガラス製モールドを離型処理 せずに用いた。
- (2) 外部離型剤処理 外部離型剤YSR-6209(東芝シ リコン製)で離型処理したガ ラス製モールドを使用した。
- (3) 外部離型剤再利用-外部離型剤 Y SR-6209で離型処理したガラス製モールドを一度使用した後、そのまま再度使用した。
- (4) P P モールド使用 射出成型したP P 製モールドをガラス製モールドの替わり に使用した。

で測定した。

耐候性:サンシャインカーボンアークランプを装備したウェザーオメーターにレンズ用樹脂をセットし、 200時間経たところでレンズ用樹脂を取り出し試験前のレンズ用樹脂と色相を比較した。標準基準は、変化なし(〇)、わずかに貴変(△)、貴変(×)とした。

面精度:目視により、面精度良好のものを(〇)、不 良のものを(×)とした。

外 観:目視により観察した。

突施例 1

5 ビスフェノールAとエピクロルヒドリンから作られたエポキシ樹脂(エポキシ当量 190)19g と、ペンタエリスリトールテトラキス(3-メルカプトプロピオネート)12.2g を混合し、トリエチルアミン 0.08g、内部離型剤としてジオクチルアシッドホスへート 0.03 g を加え、均一とした後、ガラスモールドとガスケットよりなるモールド型中に注入した。室温で 2 時間放置すると樹脂は硬化した。その後のレンズの離型も容易であった。こうして得られたレンズは、無色透明で副候性に優れ、屈折率 n。**。 = 1.58、アッベ数 37で、

.	und	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	. 0
	机弧性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 以	無低過明	п		*	n	"	н	"	2	2	H	N	11
	耐锅性	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	٥	0	0
	7048	11	34	33	35	35	13	36	11	Ħ	5	52		
	租货单	1.66	1.63	1.64	1.60	1.61	1.66	1.66	1.62	1.63	1.64	1.58	1.54	1.59
1	州郡益官所 . (ppm)	\$24-4 (2000)	08-481 (186)	EF - 381 (200)	494879-78XA-	42 - 128A (280)	19198446774= 91,5054F (2000)	191587978778 291587978 (2000)	05-403	EF-122A (200)	\$75875.F \$24-b (2880)	н	И	
- ☆	M (3)	(3.21) (13.5)	PEMP (11.2)	(8.8!)	PETG (18.8)	PETG (18.8)	TMEM") (8.8)	TMEM. (8.8)	TMEM (8.8)	PETG (10.8)	TMEM (8.8)	P E T G (10.4)	ı• V d li li	9197012版水734 段 (70)
	四州(****	DPF PG [1.1]	T U P A D G E 31	T 0 P A P G E	181 V D G 811	D P F D G E (17.4)	TOPADGE (48)	0 P P D G P	TGP DOR"	(1.(1) 4 D d 4 D T	161916/14106/417	E=899048791489F	7 11 P A D G E	100444191-1 C-94 100444191-1 C-94
		WitH-2		- 4	1 52	0 -	1 - 1	8 -	0 -	- 10	11 - 1	11 - "	1 - MW-1	2 - 4

- ビスフェノールFグリシジルエーテル:エポキシ 当量 174
- 2) ベンタエリスリトールテトラキス (メルカプトプロピオネート)
- テトラブロムビスフェノールA シグリシシルエー テル:エポキシ当量 400
- 4) ベンタエリスリトールテトラキス (チオグリコ レート)
- 5) ビスフェノール A ジグリシジルエーテル : エポキ シ当量 190
- 6) チオジフェノールジグリンジルエーテル:エポキ ン当冊 178
- 7) テトラキス (2-メルカプトエチルチオメチル) メ タン
- 8) ヘキサヒドロフタル酸
- 9) ピニルシクロヘキセンジエポキシド;エポキシ当 量75

	WH	l '	×	i	×	ı	×	ı	×
	4. 照性	×	0	×	0	×	0	×	0
	11 tr	ı	無色透明	1	10000000000000000000000000000000000000	1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	ı	斯巴 姆明
	耐损性	1	0	ı	0	I	0	-	0
	アッベ鼠	-	44	ı	\$		11	1	37
	计划位	-	1.64		1.64	-	1.60	, 1	1.68
4 - H	机模片化一子	未均理	外的独型机处理 (758-6289)	(1) 解码引) 照射 外面新知道即即从	川利オダーテムは	五以水	外 45 46 12 A1 45 (N (NS-181)	外版出版開始提得 49期(比较何多)	アヤモールド総刑
	. EE IL M (g)	TMBM (31.4)	H	"	н	P E M P (11.2)	N	*	
	エポキシ班監 (g)	(11) Jettskatvoke s- 3	17	2		11 P F D G E	*		ž.
		169309 - 3	4- "	- 5	9 - "	1- "		0 - "	01 - x

作 用

本発明のポリスルフィド系樹脂製レンズは優れた光学物性と高い面精度を有する有用なレンズであり、また本発明のレンズの製造法は工業的に極めて有利な方法である。

請求の範囲

- 1) 一分子中に二個以上のエポキシ基および/または エピスルフィド基を有するエポキシ/エピスルフィ ド樹脂と二官能以上のポリチオールと内部離型剤の 混合物を注型重合することにより得られるポリスル フィド系樹脂製レンズ。
- 2) 少なくとも1 穏のエポキシ樹脂中のエポキシ基およびエピスルフィド基の合計に対する少なくとも1 種のポリチオール中のメルカプト基のモル比が約0.1~約2.0である請求項1記載のレンズ。
- 3)少なくとも1種のエポキシ樹脂中のエポキシ基およびエピスルフィド基の合計に対する少なくとも1種のポリチオール中のメルカプト器のモル比が約
 0.2~約1.2である請求項1記載のレンズ。
- 4) 触媒の存在下に注型重合して得られる請求項 1 記載のレンズ。
- 5) 光安定剤、紫外線吸収剤を添加して注型重合して 得られる請求項1記載のレンズ。
- 6) 内部雑型剤をエポキシ樹脂とポリチオールの合計 重量に対して1~10000ppm添加して注型度 合することにより得られる請求項1記載のレンズ。
- 7) 内部離型剤が界面活性剤である請求項1記載のレンズ。
- 8) 界面活性剤がイオン型界面活性剤である請求項7

記載のレンズ。

- 9) 界面活性剤が非イオン型界面活性剤である請求項 7記載のレンズ。
- 10) イオン型界面活性剤がアニオン型界面活性剤である請求項8記載のレンズ。
- 11) イオン型界面活性剤がカチオン型界面活性剤である請求項8記載のレンズ。
- 12) アニオン型界面活性剤がリン酸エステル系界面活性剤である請求項10記載のレンズ。
- 13) カチオン型界面活性剤がアルキル第4級アンモニウム塩である請求項11記載のレンズ。
- 14) 非イオン型界面活性剤がパーフルオロアルキル基 を有し、かつ、ヒドロキシアルキル基またはリン酸 エステル基を有するフッ景系非イオン型界面活性剤 である請求項9記載のレンズ。
- 15) 非イオン型界面活性剤がジメチルポリシロキサン 基を有し、かつ、ヒドロキシアルキル基またはリン 酸エステル基を有するシリコン系非イオン型界面活 性剤である請求項 9 記載のレンズ。
- 16) リン酸エステル系界面活性剤が酸性リン酸エステル系界面活性剤である請求項12記載のレンズ。
- 17) 酸性リン酸エステル系界面活性剤がイソプロピルアシッドホスヘート、ジイソプロピルアシッドホスヘート、ブチルアシッドホスヘート、ジブチルア

製造法。

- 24) 請求項 6 記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの製造法。
- 25)請求項7記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの製造法。
- 26) 請求項 8 記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの 製造法。
- 27) 請求項9記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの製造法。
- 28)請求項10記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの製造法。
- 29) 請求項11記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの製造法。
- 30) 請求項12記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの製造法。
- 31)請求項13記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの製造法。
- 32)請求項1 4 記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの製造法。
- 33) 請求項15記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの製造法。
- 34) 請求項16記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの製造法。
- 35) 請求項17記載のポリスルフィド系樹脂製レンズ

- シッドホスペート、オクチルアシッドホスペート、 ジオクチルアシッドホスペート、イソデシルアシッ ドホスペート、ジイソデシルアシッドホスペート、 トリデカノールアシッドホスペートおよびピス (ト リデカノール) アシッドホスペートからなる群より 選ばれた1種または2種以上の化合物であることを 特徴とする請求項16記載のレンズ。
- 18) アルキル第4級アンモニウム塩がトリメチルセチルアンモニウム、トリメチルステアリルアンモニウム、トリエチルドデシルアンモニウム、トリオクチルメチルアンモニウム、ジエチルシクロヘキシルドデシルアンモニウムのハロゲン塩、リン酸塩、硫酸塩から選ばれた1種または2種以上の塩であることを特徴とする請求項13記載のレンズ。
- 19) 請求項1 記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの 製造法。
- 20) 請求項 2 記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの製造法。
- 21) 請求項3記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの 製造法。
- 22)請求項 4 記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの 製造法。
- 23)請求項5記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの

の製造法。

36) 請求項18記載のポリスルフィド系樹脂製レンズの製造法。

野 深 耳 至 母 含 xmcms+PCT/JP 8 9/004 8 4

	CETA								_				
CP+P:	a ac		2 B 1										
		60	Z B 1,	/ 0 4									
	2840	-45											
4. 6.		- X - F			7 -	÷ .	· 2	9	64				_
# #	# #				#		9						
I P	C	00	181,	/04		8G 5 9,	66.	¢	0 8 4	G 7 1	/0	•	
													_
			# 4	. 股 男 =	Bneg	単数サダ	* f7 • ≈	40	_				_
				_									
	1十多四級	KT &	ZEL										
P F - 8	tin:	ZRE .	シゾーを	10更等	5.民連する	t # 12. 2	の美運する	4世界	0 E S	• 1	11.00	EEE	3
x I	JP.	5 5	-87	1 1 2	6 (昭和	TIE	194	,			1	-31	6
	10. 1												
			99,	. (1 :	9. 0 5 <i>.</i>								
į	(77			. (1 :	9. 0 5 <i>.</i>								
	(77			. (1 :	9. 0 5.			-					
	(77			. (1 :	9. 0 5 <i>.</i>								
	(27			. (1 :	9. 0 5 <i>.</i>			٠					
	(27			. (1 :	9. 0 S.		•						
	(77			. (1 :	9. 0 S.		•						
	(77)			. (1 :	9. 05.		•	٠					
	(77				9. 0 S.								
	(77				9. 05.								
	(77				9. 0 S.								
	(27				9. 0 S <i>.</i>								
	(27				9. 0 S.			-					
a il ž		₹ 9 — ₹			9. 0 5.	84)							
IAJUE	報の介子:	79	:(-	ro Ta		(T)ES	· · 查問意义: · 步揚子等	SOTE	me < .	도소울: 보면:	・たなス	単で基金に収集	- 1
IAJ WE FEJ 27	都のカナー のカーナー であっている。	7 9 2 2 9 2 2 0 2	: (b	药度有象	at#fic	(T)ES	オカナる: 中に引用:	TASE	## (. B	異現4	スポス	作理 第4	D RE
IAJ WE FEJ 27 FLJ 22 EL	都成功の方式 政策の方式 大型工作 大型工作 大型工作 大型工作 大型工作 大型工作 大型工作 大型工作	7 9 27	(- 本)	SETAL SILVER		(T) E3	7978: 46314: 3204: 31201	ものでは するもの る文献で 世がなり	出たく。 D であって	. 東現の C、 E3 L S.A.I	EXMS	た理論な 多で無り) PE
IAJUK FEJET FLJEE EL	を表現である。 をままななな。 をまなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	アラー・セミア・マスを選択している。	にし. 一番を たのでは、 では、一番を できませて、	育日 予本 日本元 企 1 年 在 の 2 3 元 の 2 に	塩を使ぐらない またならない ないの句文 取り取りまする	(T) EX (T) EX (T) EX (T) EX (T) EX (T)	テルイ 8: 中に引用: 見退の4: 入れ当中: スカの6:	ものでは するもの る文献で 世がない る文献で	性なく。 D であって いとをが であって	表現の C、 E3 L S.A.I C、 B1	EREC SAC SAC SAC	た思数な 多で度で ちのうま	
「名」 時代 「名」 点行 「L」 を見 「L」 を見 (身 「O」 口頭 「P」 医用	都成文帝でも ののみなのでは では では では では では では では では では では では では で	アラー 大変の	: (.一番: 1	50 日 日 本	塩を使ぐらない またならない ないの句文 取り取りまする	(T) E1 (T) E1 (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T)	テカナミ 市に引用 東通の本 天化温の スた温の スた スた スた スた スた スた スた スた ス ス ス ス ス ス ス	ものでは するもの を文献で を文献で を文献で を文献で を文献で	立たく。 D であって たおって たおって たれるも	・東京の しろんは しろんは こ、単さ に登せる	EREC SAC SAC SAC	た思数な 多で度で ちのうま	
IAJUK FEJ MT FLJ ME US (S) COM FPJ ER SO	都成立の のの方は、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 で	プラー 大き 一 大き	: (.一番: 1	50 日 日 本	ので表示しない。 では、人の合うでは では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 で	(T) E1 (T) E1 (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T)	テルイを のだ引用 見通のを 及れ当か 及れ当か との。 出	ものでは するもの を文献で を文献で を文献で を文献で を文献で	立たく。 D であって たおって たおって たれるも	・東京の しろんは しろんは こ、単さ に登せる	EREC SAC SAC SAC	た思数な 多で度で ちのうま	
(A) 特氏 「E) 元行 「L) 任元 (身 (の) 日報 「P) 日本 BO	数のカナミンの大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	リアースの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの	: (.一番: 1	50 日 日 本	ので表示しない。 では、人の合うでは では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 で	(T) 53 (T) 53 (T) 73 (T) 74 (T) 75 (T) 75 (T) 75	テカイを のだ引用 及者のを 及れ当か えれらの との。 Bi パないと パクント	ものでは するない をがない をがない をでない でなる。 ファリリ	立たく。 D であって たおって たおって たれるも	・東京の しろんは しろんは こ、単さ に登せる	EREC SAC SAC SAC	た思数な 多で度で ちのうま	
(A) 時代 「E) 元行 「L) 在元 (海 (O) UM 「P) 配用 BO N. 路	部のカチン 部項目では、 ではない。 ではないない。 ではないできる。 ではないでもないでもないでもないでもないでもないでもないでもないでもないでもないでも	リアースの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの	((.一) 10 (内容の表示の のない のない のない のない のない のない のない のな	ので表示しない。 では、人の合うでは では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 で	(T) 53 (T) 53 (T) 73 (T) 74 (T) 75 (T) 75 (T) 75	テカナミ 市に引用 東通の本 天化温の スた温の スた スた スた スた スた スた スた スた ス ス ス ス ス ス ス	ものでは するない をがない をがない をでない でなる。 ファリリ	10 (東京の にあれば に、単 に、単 では な	EREC SAC SAC SAC	た思数な 多で度で ちのうま	
(A) WE (E) A7 (L) A2 (D) CH (P) EA (P) EA (P) EA (P) EA	都のカチュ が選手では、 大学ではなられる。 大学ではなりませた。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	リリーで	((.一) 10 (内容の表示の のない のない のない のない のない のない のない のな	ので表示しない。 では、人の合うでは では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 で	(T) 53 (T) 53 (T) 73 (T) 74 (T) 75 (T) 75 (T) 75	予用でも の表別の事 文化のの 次化のの がないまた がクレント:	ものでは するない をがない をがない をでない でなる。 ファリリ	10 (ARRIVED CONTRACTOR	5.89	に理論を みて無可 なのうだ せによっ	A (4)
(A) WE FE J 27 FL J 全元 (D) UM FP J ER FO J UM FP J ER FO J UM FO J UM	都のカチュ が選手では、 大学ではなられる。 大学ではなりませた。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	Type Transition of the Transit	にく、一般 は一般の は一般の は、本文学 は、本文 は 、本文 は 、本文	FIGTOR Parcel Parcel FIGTOR P	ので表示しない。 では、人の合うでは では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 で	(T) (E) (T) (E) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T	テルマラー では、	ものでもできませんが、これをは、大きないでは、大きないでは、大きないでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	10 (ARRIVED CONTRACTOR	5.89	7 1	100 A

【公報種別】特許法第17条第1項及び特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成8年(1996)10月8日

【国際公開番号】WO89/10575

【年通号数】

【出願番号】特願平1-504942

【国際特許分類第6版】

G02B 1/04

9219-2H

手続補正書

半成8年1月:7日

特許疗長官

殿

1. 事件の表示 平成1年 特許額 第504942号

2.補王をする岩

事件との関係 特許出級人 名称(氏名) 三井東圧化学株式会社

3. 代 理 人

生所 東京都路区赤坂1 F日9 数2 0 以 第1 6 興和ビル<u>県</u>歌

氏名 井匹士(7021) パ 林

1. 補正の対象 請求の範囲及び明知也。

- 5、箱花の内ギ
- 1) 前求の額囲を別紙の通り確定する。

2) 明剛当第2月第18斤~18行に記載の「しかし、エポキシ問覧をポリテオ・ルで使 化させてレンズを持ち技術は知られていなかった。」を「しかし、これらの公知のエポキ シ問題によるレンズは、DACを用いたレンズよりも面好率に向上するものの、まだ。不 お好であったり、また、配好がを向上させるために、分子内に多数のハログン果で使いば、 方き保を有する化合物を用いているために、分数が大きい、耐候性が思い、或いは比重が 大きいといった欠点を有している。」に抽訳する。

- 3) 明細資第2頁第20行に記載の「一方、」を「ところで、」に舗正する。
- 4) 明細書第3頁第13行~第19万に記載の「前述の・・・している。」を開降する。
- 5) 労組責第3頁第20行に記載の「一方、」を削除する。
- 6) 列和音第1 7 頁第1 行に配載の(アセテ・ト)、」と「1.4-ジチアン」の関に「2.5-ビス(メルカプトメチル)-1.4-ジチアン」を挿入する。
- 7) 判別者第20項第11行に記録の「白海し好ましくない。」を「白裔する場合があり好ましくないが、この頃はモノマー和成、内部様項和の種類によっても異なるため、限定的なものではない。」に補正する。

(別紙)

請求の範囲

- 1) 分子中に、個以上のエポキシ系および/またはエピスルフィド基を有するエポキシ/エピスルフィド母類と二官億以上のポリオチ・ルと内部権選別の混合物を注型量合することにより得られるポリスルフィド系労働額レンズ。
- 2) エポキシ/エピスルフィド樹唐中のエポキシ落老よびニピスルフィド基の合乱に対し、 ポリチオール中のメルカプト基のモル比が0、1~2、0である諸米項1記録のレン。
 ぶ。
- 3) <u>エポキシ/エピスルフィド場的中のエポキシ及およびエピスルフィド県の合計に3</u>3 し、ポリチオール中のメルカプト次のモル比がり、2~1、2である商東項1加速のレン ズ
- 4) 内部属型制が単面法性制である領求項:制载のレンズ。
- 6) 界面活性剤がイオン型界面活性気である請求項4記載のシンズ。
- 6) 界面活生剤が非イオン與界面が性別である治水項1包盤のレンズ。
- 7) <u>分子中に二個ステの工売キシ基的よび/東次はエピスルフィドルを打する工売キシノエピスルフィド樹脂と、近地以上のポリテオールと内部産型例の混合物を注型</u>現在主 <u>台頭米県1割割のポリスルフィド系出版型レンズの製造法。</u>

(1) Publication number:

0 374 258 A1

(12)

EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art. 158(3) EPC

(21) Application number: 89905186.6

(51) Int. Cl.5: G02B 1/04

② Date of filing: 01.05.89

(68) International application number: PCT/JP89/00454

International publication number:
 WO 89/10575 (02.11.89 89/26)

(2) Priority: 30.04.88 JP 105466/88

Date of publication of application: 27.06.90 Bulletin 90/26

Designated Contracting States:
 AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

 Applicant: MITSUI TOATSU CHEMICALS, INCORPORATED
 2-5, 3-chome, Kasumigaseki Chlyoda-ku Tokyo(JP)

Inventor: KANEMURA, Yoshinobu 2882, lijimacho Sakae-ku Yokohama-shi Kanagawa 244(JP)

Inventor: SASAGAWA, Katsuyoshi 1510, Shinyoshidacho Kohoku-ku Yokohama-shi Kanagawa 223(JP)

Inventor: IMAI, Masao 1-11-10, Hashido Seya-ku Yokohama-shi Kanagawa 246(JP)

Representative: Stuart, Ian Alexander et al MEWBURN ELLIS & CO. 2/3 Cursitor Street London EC4A 1BQ(GB)

- (S) HIGH REFRACTIVE INDEX LENS AND METHOD FOR ITS PRODUCTION.
- This invention relates to a polysulfide resin lens and a method of its production comprising cast polymerisation of a mixture of an epoxy/episulfide resin having at least two epoxy groups and/or episulfide groups in one molecule, at least bifunctional polythiol and an internal mold releasing agent. The present invention provides a lens having excellent optical characteristics and high planar accuracy.

臣0

_ 1 _

SPECIFICATION

Title of the Invention

5

25

Polysulfide Base Resin Lens and Process for Preparing the Same

Background of the Invention

1. Field of the Invention

polysulfide base resin lens, comprising that a mixture of at least one epoxy and/or episulfide resin (hereinafter referred to as epoxy resin) having at least two epoxy groups and/or episulfide groups, and at least one polythiol compound having at least two functional groups and at least one internal releasing agent is casted, and the process for preparing the same. Plastic lenses are lightweight, less fragile than inorganic lenses and can be dyed with ease.

20 2. Description of the Prior Art

A resin currently widely used in lenses is a radical polymerization product of diethylene glycol bisallyl carbonate (hereinafter referred to as DAC). The resin has excellent impact resistance, is lightweight, has prominent dye-affinity and good machinability including cutting

ability and polishing ability.

5

10

15

20

25

However, lenses prepared from the resin have a smaller refractive index $(n_D=1.50)$ than inorganic lenses $(n_D=1.52)$. In order to obtain equivalent optical properties to glass lenses, it is necessary to increase the center thickness, peripheral thickness and curvature of the lens and hence the lens as a whole becomes inevitably thick. Therefore, resins providing a higher refractive index are desired.

Other resins which have been proposed to provide high refractive indexes include resins obtained by reacting an epoxy resin with acrylic acid or methacrylic acid and subsequently radical polymerizing the resultant epoxy (meth)acrylate compound (Japanese Patent Laid-Open No. 164607/1983), resins obtained by curing an epoxy resin with acid anhydride (Japanese Patent Laid-Open No. 164618/1983 and 22001/1984), resins obtained by curing an epoxy resin with acid anhydride in admixture with a vinyl monomer (Japanese Patent Laid-Open No. 164617/1983), resins obtained by curing an epoxy resin with an aromatic compound having phenolic hydroxyl groups (Japanese Patent Laid-Open No. 24201/1988); and resins obtained by copolymerizing epoxy resins with each other (Japanese Patent Laid-Open No.

93720/1984).

No prior art, however, has been known on the preparation of lens by curing epoxy resins with polythiol compounds.

On the other hand, plastic lenses are a rigid body completely free from bubbles that is required to have a high surface accuracy, such an optical homogeneity that any strain cannot be found by an optical strain meter, and a high transparency. Generally, as a method of making 10 plastic lenses, use is made of cutting and abrading, hot press molding, cast molding, injection molding or the like, and when a thermosetting resin such as DAC is used as a material, cast molding is used. In this case, the releasability between the lens 15 and the mold is important, and if the release is premature, the lens surface is disturbed, or the lens is liable to be strained, whereas if the release becomes difficult, the exfoliation of the mold takes place. Although it is known that butyl 20 phosphate is used as a releasing agent for DAC, generally it is not preferable to use an internal releasing agent inview of the physical properties of the lens (see "Polymer Digest" by Seiichi Miuma, 3, 39 (1984), etc.). 25

However, generally when epoxy resin base

5

1.5

lens is casted, the adhesion between the lens and the mold is so good that the lens cannot be released from the mold easily.

However, although lenses prepared from the preceding resins, have higher refractive indices than lenses prepared from DAC, the lenses do not exhibit the desired high refractive indices. Further, since such resins are prepared from compounds containing many halogen atoms or aromatic rings to improve the refractive index, lenses 10 prepared from these resins have disadvantages such as large dispersion of refractive index, poor weatherability and high specific gravity.

On the other hand, as a method of improving the releasability for casting epoxy resin base lenses, we have tried a method of treating the mold with an external releasing agent anda method that uses a mold of a polyolefin resin.

However, the method wherein a fluorine type external releasing agent or a silicon type 20 external agent is used to form a release film on the mold was accompanied by such problems that the thickness of the release film was difficult to become constant, part or all of the release film was transferred to the surface of the 25 polymerized lens or into the inside of the

polymerized lens to deteriorate the surface state extremely, and more specifically the surface was made ununiform or the lens became turbid. In addition, because it was required to treat the mold with a releasing agent every time when the mold was used repeatedly, it was found that the method was troublesome as an industrial lens molding method, the productivity of the lens by the method was low, and the method was quite uneconomical.

On the other hand, in the method that uses a mold of a polyolefin resin, because a high temperature deforms the resin mold, the surface accuracy of the molded lens was poor, and it was found that, in the field of optical lenses and lenses for glasses wherein a high surface accuracy is required, the method was required to be more improved.

Summary of the Invention

5

The inventors have studied to find that

a polysulfide base resin lens, comprising that
a mixture of epoxy resin and polythiol compound
and an internal releasing agent is casted, can provide
excellent opticophysical properties and a high
surface accuracy without a special surface treatment
of the glass that is generally used as a mold,
leading to the present invention.

That is, the present invention relates to a polysulfide base resin lens, comprising that a mixture of at least one epoxy and/or episulfide resin having at least two epoxy groups and/or episulfide groups, and at least one polythiol compound having at least two functional groups, and at least one internal releasing agentis casted, and the process for preparing the same. Detailed Description of the Invention

Reference will now be in detail to the present preferred embodiments of the invention.

Exemplary epoxy resins suitable for use in the practice of this invention include:

Amine base epoxy resin (i)

5

10

Amine base epoxy resins contain a group 15 of the formula $> N-CH_2-CH-CH_2$ and include, for example, resins prepared by reacting compounds having amino groups and/or amide groups such as N,N,N',N'-tetraglycidyldiaminodiphenylmethane, m-N, N-diglycidylaminophenylglycidyl ether and 20 N,N,N',N'-tetraglycidylterephthalamide, with epihalohydrins such as epichlorohydrin, methylepichlorohydrin and epibromohydrin.

Exemplary suitable compounds having amino groups include diaminodiphenylmethane, 25 m-xylylenediamine, p-xylylenediamine,

m-aminobenzylamine, p-aminobenzylamine,

- 1,3-bis(aminomethyl)cyclohexane,
- 1.4-bis(aminomethyl)cyclohexane,
- 1,3-diaminocyclohexane, 1,4-diaminocyclohexane,
- m-phenylenediamine, p-phenylenediamine, benzylamine, diaminodiphenyl sulfone, diaminodiphenyl ether, diaminodiphenyl sulfide, diaminodiphenyl ketone, naphthalenediamine, aniline, toluidine, m-aminophenol, p-aminophenol and aminonaphthol.
- Exemplary suitable compounds having amide groups include phthalamide, iso-phthalamide, terephthalamide, benzamide, toluamide, p-hydroxybenzamide and m-hydroxybenzamide.

When the compounds containing amino groups

and/or amide groups also contain epihalohydrin

reactive groups such as hydroxyl groups, carboxyl

groups and mercapto groups in addition to the amino

groups or amide groups, a part or whole of these

epihalohydrin reactive groups may be reacted with

20 epihalohydrin to form epoxy groups.

(ii) Phenol base epoxy resins

25

Phenol base epoxy resins such as bisphenol-A diglycidyl ether and EPOTOTO YDCN-220^m (a product of Toto Kasei Co., Ltd.) can be prepared by reacting phenol base compounds with epihalohydrins.

Exemplary suitable phenol base compounds include hydroquinone, catechol, resorcinol, bisphenol-A, bisphenol-F, bisphenol sulfone, brominated bisphenol-A, novolac resin, cresol novolac resin, tetra(hydroxyphenyl)ethane and tri(hydroxyphenyl)ethane.

(iii) Alcohol base epoxy resin

5

10

Exemplary suitable resins include trimethylolpropane triglycidyl ether and neopentyl glycol diglycidyl ether. The resins can be prepared by reacting alcohol base compounds with epihalohydrins.

Exemplary alcohol base compounds suitable for use in the process of the invention include polyhydric alcohols such as ethylene glycol, 15 diethylene glycol, triethylene glycol, polyethylene glycol, propylene glycol, dipropylene glycol, polypropylene glycol, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, neopentyl glycol, dibromoneopentyl glycol, trimethylolpropane, glycerol, pentaerythritol, 20 polycaprolactone, polytetramethylene ether glycol, polybutadiene glycol, hydrogenated bisphenol-A, cyclohexanedimethanol, bisphenol-A ethyleneoxide adduct and bisphenol-A.propyleneoxide adduct; and polyester polyols prepared from the above polyhydric 25 alcohols and polyatomic carboxylic acids.

- (iv) Epoxylated products of unsaturated compounds

 Exemplary suitable epoxylated products

 of unsaturated compounds include

 cyclopentadienediepoxide, epoxylated soy bean oil,

 epoxylated polybutadiene, vinylcyclohexenepoxide

 and ERL-4221^m, ERL-4234^m and ERL-4299^m (products

 of Union Carbide Corp.).
- (v) Glycidyl ester base epoxy resin

5

Exemplary suitable glycidyl ester base

10 epoxy resins include tetrahydrophthalic acid
diglycidyl ester and the like. The resins can
be prepared by reacting carboxylic acids with
epihalohydrins.

Exemplary carboxylic acids suitable for

use in the process of the invention include

polyatomic carboxylic acids such as adipic acid,

sebacic acid, dodecanedicarboxylic acid, dimer

acid, phthalic acid, isophthalic acid, terephthalic

acid, tetrahydrophthalic acid,

- 20 methyltetrahydrophthalic acid, hexahydrophthalic acid, fetic acid, nadic acid, maleic acid, fumaric acid, trimellitic acid, benzenetetracarboxylic acid, butanetetracarboxylic acid, benzophenonetetracarboxylic acid and 5-(2,5-dioxotetrahydrofuryl)-325 methylcyclohexene-1,2-dicarboxylic acid.
 - (vi) Urethane base epoxy resin

Urethane base epoxy resins can be prepared by reacting the polyhydric alcohols set forth in section (iii) with diisocyanates and glycidols.

Exemplary suitable diisocyanates include

tolylene diisocyanate,
diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, hexamethylene
diisocyanate, isophorone diisocyanate, xylylene
diisocyanate and naphthalene diisocyanate.

(vii) Alicyclic epoxy resins

- for use in the invention include alicyclic epoxy
 resins such as 3,4-epoxycyclohexyl-3,4epoxycyclohexanecarboxylate, vinylcyclohexenedioxide,
 2-(3,4-epoxycyclohexyl-5,5-spiro-3,4-epoxy)cyclohexane-m-dioxane and bis(3,4-epoxycyclohexyl)-
- cyclohexane-m-dioxane and bis(3,4-epoxycyclohexyl)adipate.

(viii) Other epoxy resin

20

25

the process of the invention includes

tris(epoxypropyl) isocyanurate, glycidyl

(meth)acrylate copolymer, diisocyanate compounds

of the above epoxy resin and resins modified with

dicarboxylic acid, polyhydric phenol and the like.

Other epoxy resins suitable for use in

Epoxy resins obtained by partly or entirely converting the epoxy groups in the epoxy resins set forth in sections (i)-(viii) above to episulfide

groups are also suitable for use in the process of the invention.

The above resins may be used singly or in combination as a mixture.

- Exemplary polythiol compounds having
 two or more functional groups suitable for use
 in the process of the invention include aliphatic
 polythiols such as methanedithiol, 1,2-ethanedithiol,
 1,1-propanedithiol, 1,2-propanedithiol,
- 1,3-propanedithiol, 2,2-propanedithiol,
 1,6-hexanedithiol, 1,2,3-propanetrithiol,
 1,1-cyclohexanedithiol, 1,2-cyclohexanedithiol,
 - 2,2-dimethylpropane-1,3-dithiol,
 - 3,4-dimethoxybutane-1,2-dithiol,

2,3-dimercaptosuccinate,

- 2-methylcyclohexane-2,3-dithiol,
 bicyclo[2,2,1]hepta-exo-cis-2,3-dithiol,
 1,1-bis(mercaptomethyl)cyclohexane,
 bis(2-mercaptoethyl)thiomalate, 2-mercaptoethyl-
- 2,3-dimercapto-1-propanol(2-mercaptoacetate),
 2,3-dimercapto-1-propanol(3-mercaptopropionate),
 diethylene glycol bis(2-mercaptoacetate), diethylene
 glycol bis(3-mercaptopropionate),
 - 1,2-dimercaptopropyl methyl ether,
- 2,3-dimercaptopropyl methyl ether, 2,2-bis(mercaptomethyl)-1,3-propanedithiol,

bis(2-mercaptoethyl)ether, ethylene glycol bis(2-mercaptoacetate), ethylene glycol bis(3-mercaptopropionate), trimethylolpropane bis(2-mercaptoacetate), trimethylolpropane bis(3-mercaptopropionate), pentaerythritol 5 tetrakis(2-mercaptoacetate) and pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate); halogen-substituted compounds such as chlorine-substituted compounds and bromine-substituted compounds of the above aliphatic polythiols; aromatic polythiols such 10 as 1,2-dimercaptobenzene, 1,3-dimercaptobenzene, 1,4-dimercaptobenzene, 1,2-bis(mercaptomethyl)benzene, 1,3-bis(mercaptomethyl)benzene, 1,4-bis(mercaptomethyl)benzene, 15 1,2-bis(mercaptoethyl)benzene, 1,3-bis(mercaptoethyl)benzene, 1,4-bis(mercaptoethyl)benzene, 1,2-bis(mercaptomethyleneoxy)benzene, 1,3-bis(mercaptomethyleneoxy)benzene, 20 1,4-bis(mercaptomethyleneoxy)benzene, 1,2-bis(mercaptoethyleneoxy)benzene, 1,3-bis(mercaptoethyleneoxy)benzene, 1,4-bis(mercaptoethyleneoxy)benzene, 1,2,3-trimercaptobenzene, 1,2,4-trimercaptobenzene, 25 1,3,5-trimercaptobenzene,

```
1,2,3-tris(mercaptomethyl)benzene,
      1,2,4-tris(mercaptomethyl)benzene,
      1,3,5-tris(mercpatomethyl)benzene,
      1,2,3-tris(mercaptoethyl)benzene,
      1,2,4-tris(mercaptoethyl)benzene,
 5
      1,3,5-tris(mercaptoethyl)benzene,
      1,2,3-tris(mercaptomethyleneoxy)benzene,
      1,2,4-tris(mercaptomethyleneoxy)benzene,
      1,3,5-tris(mercaptomethyleneoxy)benzene,
      1,2,3-tris(mercaptoethyleneoxy)benzene,
10
      1,2,4-tris(mercaptoethyleneoxy)benzene,
      1,3,5-tris(mercaptoethyleneoxy)benzene,
      1,2,3,4-tetramercaptobenzene,
      1,2,3,5-tetramercaptobenzene,
      1,2,4,5-tetramercaptobenzene,
15
      1,2,3,4-tetrakis(mercaptomethyl)benzene,
      1,2,3,5-tetrakis(mercaptomethyl)benzene,
      1,2,4,5-tetrakis(mercaptomethyl)benzene,
      1,2,3,4-tetrakis(mercaptoethyl)benzene,
      1,2,3,5-tetrakis(mercaptoethyl)benzene,
20
      1,2,4,5-tetrakis(mercaptoethyl)benzene,
      1,2,3,4-tetrakis(mercaptomethyleneoxy)benzene,
      1,2,3,5-tetrakis(mercaptomethyleneoxy)benzene,
      1,2,4,5-tetrakis(mercaptomethyleneoxy)benzene,
      1,2,3,4-tetrakis(mercaptoethyleneoxy)benzene,
25
```

1,2,3,5-tetrakis(mercaptoethyleneoxy)benzene,

```
1,2,4,5-tetrakis(mercaptoethyleneoxy)benzene,
     2,2'-dimercaptobiphenyl, 4,4'-dimercaptobiphenyl,
     4,4'-dimercaptobibenzyl, 2,5-toluenedithiol,
     3,4-toluenedithiol, 1,4-naphthalenedithiol,
     1,5-naphthalenedithiol, 2,6-naphthalenedithiol,
5
     2,7-naphthalenedithiol,
     2,4-dimethylbenzene-1,3-dithiol,
     4,5-dimethylbenzene-1,3-dithiol,
     9,10-bis(mercaptomethyl)anthracene,
     1,3-di(p-methoxyphenyl)propane-2,2-dithiol,
10
      1,3-diphenylpropane-2,2-dithiol,
     phenylmethane-1,1-dithiol and
     2,4-di(p-mercaptophenyl)pentane; halogen-substituted
     aromatic polythiols including chlorinated derivatives
     and brominated derivatives of the above polythiols
15
     such as 2,5-dichlorobenzene-1,3-dithiol,
     1,3-di(p-chlorophenyl)propane-2,2-dithiol,
     3,4,5-tribromo-1,2-dimercaptobenzene and
     2,3,4,6-tetrachloro-1,5-bis(mercaptomethyl)benzene;
     heterocyclic ring containing polythiols such as
20
     2-methylamino-4,6-dithiol-sym-triazine,
     2-ethylamino-4,6-dithiol-sym-triazine,
     2-amino-4,6-dithiol-sym-triazine,
     2-morpholino-4,6-dithiol-sym-triazine,
     2-cyclohexylamino-4,6-dithiol-sym-triazine,
25
      2-methoxy-4,6-dithiol-sym-triazine,
```

2-phenoxy-4,6-dithiol-sym-triazine,
2-thiobenzeneoxy-4,6-dithiol-sym-triazine and
2-thiobutyloxy-4,6-dithiol-sym-triazine; and
halogen-substituted compounds including
chlorine-substituted derivatives and bromine
substituted derivatives of the above heterocyclic
ring containing polythiols.

Exemplary polythiol compounds having at least two functional groups and containing sulfur atoms in addition to mercapto groups include, for 10 example, aromatic polythiols such as 1,2-bis(mercaptomethylthio)benzene, 1,3-bis(mercaptomethylthio)benzene, 1,4-bis(mercaptomethylthio)benzene, 1,2-bis(mercaptoethylthio)benzene, 15 1,3-bis(mercaptoethylthio)benzene, 1,4-bis(mercaptoethylthio)benzene, 1,2,3-tris(mercaptomethylthio)benzene, 1,2,4-tris(mercaptomethylthio)benzene, 1,3,5-tris(mercaptomethylthio)benzene, 20 1,2,3-tris(mercaptoethylthio)benzene, 1,2,4-tris(mercaptoethylthio)benzene, 1,3,5-tris(mercaptoethylthio)benzene, 1,2,3,4-tetrakis(mercaptomethylthio)benzene, 1,2,3,5-tetrakis(mercaptomethylthio)benzene, 25 1,2,4,5-tetrakis(mercaptomethylthio)benzene,

1,2,3,4-tetrakis(mercaptoethylthio)benzene, 1,2,3,5-tetrakis(mercaptoethylthio)benzene, 1,2,4,5-tetrakis(mercaptoethylthio)benzene and benzene ring alkylated compounds of these aromatic polythiols; aliphatic polythiols such as 5 bis(mercaptomethyl) sulfide, bis(mercaptoethyl) sulfide, bis(mercaptopropyl) sulfide, bis (mercaptomethylthio) methane, bis(2-mercaptoethylthio)methane, bis(3-mercaptopropylthio)methane, 10 1,2-bis(mercaptomethylthio)ethane, 1,2-bis(2-mercaptoethylthio)ethane, 1,2-bis(3-mercaptopropylthio)ethane, 1,3-bis(mercaptomethylthio)propane, 1,3-bis(2-mercaptoethylthio)propane, 15 1,3-bis(3-mercaptopropylthio)propane, 1,2,3-tris(mercaptomethylthio)propane, 1,2,3-tris(2-mercaptoethylthio)propane, 1,2,3-tris(3-mercaptopropylthio)propane, tetrakis(mercaptomethylthiomethyl)methane, 20 tetrakis(2-mercaptoethylthiomethyl)methane, tetrakis(3-mercaptopropylthiomethyl)methane, bis(2,3-dimercaptopropyl) sulfide, 2,5-dimercapto-1,4-dithian, bis(mercaptomethyl) disulfide, bis(mercaptoethyl) disulfide, 25 bis(mercaptopropyl) disulfide, thioglycolic acid

and thiopropionic acid esters of the above aliphatic polythiols, hydroxymethylsulfidebis(2-mercaptoacetate), hydroxymethylsulfidebis(3-mercaptopropionate), hydroxyethylsulfidebis(2-mercaptoacetate), hydroxyethylsulfidebis(3-mercapto-5 propionate), hydroxypropylsulfidebis(2-mercaptoacetate), hydroxypropylsulfidebis(3-mercaptopropionate), hydroxymethyldisulfidebis(2-mercaptoacetate), hydroxymethyldisulfidebis(3-mercaptopropionate), hydroxyethyldisulfidebis(2-mercapto-10 acetate), hydroxyethyldisulfidebis(3-mercaptopropionate), hydroxypropyldisulfidebis(2-mercaptoacetate), hydroxypropyldisulfidebis(3-mercaptopropionate), 2-mercaptoethyl ether bis(2-mercaptoacetate), 2-mercaptoethyl ether 15 bis(3-mercaptopropionate), 1,4-dithian-2,5-diolbis(2-mercaptoacetate), 1,4-dithian-2,5-diolbis(3-mercaptopropionate), thiodiglycolic acid bis(2-mercaptoethyl ester), thiodipropionic acid bis(2-mercaptoethyl ester), 20 4,4-thiodibutyric acid bis(2-mercaptoethyl ester), dithiodiglycolic acid bis(2-mercaptoethyl ester), dithiodipropionic acid bis(2-mercaptoethyl ester), 4,4-dithiodibutyric acid bis(2-mercaptoethyl ester), thiodiglycolic acid bis(2,3-dimercaptopropyl ester), 25 thiodipropionic acid bis(2,3-dimercaptopropyl ester), 5

10

15

20

25

dithioglycolic acid bis(2,3-dimercaptopropyl ester) and dithiodipropionic acid bis(2,3-dimercaptopropyl ester); and heterocyclic polythiols such as 3,4-thiophenedithiol, bismuthiol and

2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazol. Halogen-substituted polythiols such as chlorine substituted derivatives and bromine substituted derivatives containing sulfur and mercapto groups in a molecule may also be used. These compounds may be used alone or in combination as a mixture.

The mole ratio of the mercapto groups in the polythiol compounds to the epoxy resin having two or more epoxy groups and/or episulfide groups from about 0.1 to about 2.0 moles, preferably from about 0.2 to about 1.2 moles of mercapto groups per mole of the sum of functional epoxy and episulfide groups.

The internal releasing agents used in the present invention are surface active agents, wax, organosilane compounds, and organofluoro compounds. Among others, surface active agents are used preferably.

The surface active agents used in the present invention are roughly classified into ionic surface active agents and nonionic surface active agents, and the ionic surface active agents are

· 5

10

15

20

25

further classified into anionic surface active agents and cationic surface active agents.

agents include sulfuric acid esters, sulfonic acid esters and phosphoric acid esters, preferably phosphoric acid esters. Among those, acidic phosphoric acid esters are best. Typical examples of the acidic phosphoric acid ester anionic surface active agents include isopropyl acid phosphate, diisopropyl acid phosphate, butyl acid phosphate, dibutyl acid phosphate, octyl acid phosphate, dioctyl acid phosphate, isodecyl acid phosphate, diisodecyl acid phosphate, dodecanol acid phosphate, and bis(tridecanol) acid phosphate.

The cationic surface active agents are alkyl quaternary ammonium salts that include halogen salts, phosphates, and sulfates of alkyl quaternary ammoniums, and specific examples thereof in the form of chlorides are trimethylcetyl ammonium chloride, trimethylstearyl ammonium chloride, dimethylethylcetyl ammonium chloride, triethyldodecyl ammonium chloride, trioctyldodecyl ammonium chloride, and diethylcyclohexyldodecyl ammonium chloride.

The nonionic surface active agents include polyoxyalkyl fatty acid esters, polyoxyalkyl ethers, compounds having a dimethyl polysiloxane group

5

and a hydroxyalkyl group or a phosphate group, and compounds having a perfluoroalkyl group and a hydroxyalkyl group or a phosphate ester group, and a specific example of the silicon base compound is Q2-120A produced by Dow Chemical Company in U.S.A., and specific examples of the fluorine base compounds are Unidain DS-401 (produced by Daikin Kogyo Co., Ltd.), Unidain DS-403 (produced by Daikin Kogyo Co., Ltd.), F-Top EF-122A (Shin-akita Chemical Co., Ltd.), F-Top EF-126 (Shin-akita Chemical Co., 10 Ltd.), and F-Top EF-301 (Shin-akita Chemical Co., Ltd.).

These surface active agents may be used alone or as a mixture of two or more of them. These surface active agents will be suitably selected 15 depending on the combination of monomers used, the polymerization conditions, the economy or the easiness of the handling of the surface active agent. The amount of the surface active agent to be used or the amount of a mixture of the surface 20 active agents to be used is in the range of 1 to 10,000 ppm, for the total amount of the epoxy resin and the polythiol. If the amount of the surface active agent to be used is below 1 ppm, the releasability becomes extremely poor, while if 25 the amount is over 10,000 ppm, the release of the

5

10

15

molded product will take place during the cast polymerization, which is not preferable because not only the surface accuracy of the lens will be deteriorated but also the produced lens will unfavorably become turbid and whitish.

Known catalysts for use in the curing of epoxy resin can be employed to accelerate curing in this invention. Exemplary suitable catalysts include tertiary amines, salts of tertiary amines, quaternary ammonium salts, metal salts and various kinds of imidazols.

rurthermore, in the present invention, various additives may be added to the above raw materials. Exemplary suitable additives include a light stabilizer, an ultraviolet absorber, an anti-oxidant, an oil-soluble dye and a filler.

The present lens is obtained by cast polymerization.

20 having at least two functional groups, and an internal releasing agent aremixed. If necessary, a catalyst and other additives are further added, the mixture is deaerated fully, and the uniform monomer/additive mixture is cast into a mold, and is polymerized. The mold comprises a combination of a resin gasket and a metal or glass mold, and

the material of the mold is preferably glass in view, for example, of the operability, the productivity, and the surface accuracy of the lens that will be obtained.

Although the polymerization temperature and the polymerization time are selected suitably depending on the type of the monomers, the release agent, the additives such as the catalyst, and the shape and the thickness of the lens to be obtained. Generally, the lens is polymerized and cured at low temperature substantially short of generating optical strain in the lens. Further, after polymerization, the mold may be heated at a temperature more than curing temperature, preferably 100°C or more to ease releasing the lens.

The thus obtained present polysulfide base resin lens has a high surface accuracy and excellent opticophysical properties, is light in weight, and excellent in impact resistance, and can be suitably used as a lens for glasses and cameras.

If necessary, the present lens can be further improved, for example, the lens can be improved in reflection prevention, can be hardened further, or can be made more fashionable, so that physical treatment or chemical treatment such as

20

25

surface abrasion, antistatic treatment, hard coat treatment, antireflection coat treatment, dyeing treatment, and light control treatment can be carried out for the lens.

The invention will be further described and clarified by the following examples and comparative examples which are intended to be purely exemplary of the invention.

The performance tests of the resins and
lenses, specifically the tests of refractive index,
Abbe's number, weatherability, mold releasability
and surface accuracy were carried out by the
following procedure:

Refractive index and Abbe's number:

Measured at 20°C with a Pulfrich refractometer.

Weatherability:

25

A lens resin was set in a weatherometer equipped with a sunshine carbon arc lamp. The

lens was taken out after 200 hours and its hue was compared with that of a lens resin before the test. Evaluation was classified into no change (O), slight yellowing (A), and yellowing (X).

Appearance:

It was evaluated by visual observation.

Mold releasability: When the release

was easy after the completion of the polymerization, it was marked with O, whereas when part or all of the product was not released after the completion of the polymerization, it was marked with \times .

Surface accuracy: It was evaluated by visual, and when it was good, it was marked with \bigcirc , whereas when observation was bad, it was marked with \times .

Example 1

5

20

After mixing 19 g of epoxy resin (epoxy equivalent 190) prepared from bisphenol-A and epichlorohydrin with 12.2 g of pentaerythritoltetrakis(3-mercaptopropionate), 0.08 g of triethylamine and 0.03 g of internal releasing agent (dioctyl acid phosphate) were added and thoroughly mixed.

The resulting mixture was poured into a mold composed of a mold and a gasket, and allowed to stand for 2 hours at room temperature to cure the resin. The lens was easily released from mold. The lens thus obtained was colorless and transparent, excellent in weatherability, and had a refractive index n_D^{20} of 1.58 and an Abbe's number of 37. The lens have high surface accuracy.

Examples 2 to 12 and Comparative Examples 1 to 2

Following the procedure of Example 1,

lenses were prepared in composition ratios shown in Table 1. The results of performance tests are set forth in Table 1.

Comparative Examples 3-10

15

25

- The same procedure of Example 1 were carried out for preparing lenses except that mold were used under conditions described below and compositions described in Table-2 were used. The results were summarized in Table-2. The descriptions in the mold treatment column in Table-2 also indicated the following conditions.
 - (1) No treatment A glass mold was used without any release treatment.
 - (2) External release treatment External mold releasing agent YSR-6209TM (product of Toshiba Silicon Co.) was applied and baked on the inner surface of a glass mold.
- (3) Reuse of external release treatment The glass mold obtained by the external release treatment was once employed for the polymerization and then used again without any further treatment.
 - (4) Use of PP mold Λ polypropylene mold was prepared by injection molding and used in place of the glass mold without any surface treatment.

Table-1

	Epoxy resin	Curing agent (g)	Internal releasing agent (ppm)	Refractive index	Abbe's number	Weather- ability	Appear- ance	Release character- istics	Surface
Example-2 BPFDGE		PEMP ²⁾ (12,2)	Dibutyl acid phosphate (2000)	1.60	37	0	Colorless and transparent	0	0
Example-3	TBPADGE ³⁾ (40)	PEMP (12.2)	DS-401 (100)	1.63	34	0	ditto	0	0
Example-4	TBPADGE (40)	PETG ⁴⁾ (10.8)	EF-301 (200)	1.64	33	0	ditto	0	0
Example-5	BPADGE ⁵⁾ (19)	PETG (10.8)	Octyl acid phosphate (1500)	1.60	35	0	ditto	Ο	0
Example-6 BPFDGE	BPFDGE (17.4)	PETG (10.8)	Q2-120A (200)	1.61	35	0	ditto	0	0
Example-7 TBPADGE	TBPADGE (40)	IMEM ⁷⁾ (8.8)	trimethyl-cetyl ammonium chloride (2000)	1.66	33	0	ditto	0	0
Example-8 BPFDGE	3 BPFDGE (17.4)	TMEM (8.8)	triethyl-decyl ammonium chloride (2000)	1.64	34	0	ditto	O ,	0
Example-9	Example-9 TGPDGE ⁸⁾ (17.8)	TWEW (8.8)	DS-403 (150)	1.62	33	0	ditto	0	0

Table-1 (cont'd)

Surface accuracy	0	0	0	0	O .
Release character- istics	0	0	0	0	0
Appear- ance	Colorless and trans- parent	ditto	ditto	ditto	ditto
Weather- ability	0	0	0	0	0
Abbe's number	<u>ج</u>	44	25		
Refractive index	1.63	1.64	1.58	1.54	1.59
Internal releasing agent (ppm)	EF-122A (200)	Dibutyl acid phosphate (2000)	ditto	ditto	ditto
Curing agent (g)	PETG (10.8)	TMEM (8.8)	PETG (10.8)	HHPA ⁸⁾	Tetrabromo phtharic acid anhydride (70)
Epoxy resin	TGPDGE (17.8)	Example-11 Vinylcyclo- hexene diepoxide (20)	ditto (20)	TBPADGE (40)	3,4-Epoxycyclo- hexylmethyl- 3,4-epoxycyclo- hexane carboxylate (30)
	Example-10 IGPDGE	Example-11	Example-12	Comp. Example-1	Comp. Example-2

1) Bisphenol-F diglycidyl ether: Epoxy equivalent 174
2) Pentaerythritoltetrakis(mercaptopropionate)

Tetrabromobisphenol-A diglycidyl ether: Epoxy equivalent 400 Pentaerythritoltetrakis(thioglycolate)
Bisphenol-A diglycidyl ether: Epoxy equivalent 190
Thiodiphenol diglycidyl ether: Epoxy equivalent 178
Tetrakis(2-mercaptoethylthiomethyl)methane
Hexahydrophthalic acid

Vinylcyclohexene diepoxide: Epoxy equivalent 75 8300588 8

Table-2

	Epoxy resin	Curing agent (g)	Mold treatment	Refrac- tive index	Abbe's number	Weather- ability	Appear- ance	Release character- istic	Surface accuracy
Comp. Example-3	Vinylcyclo- hexene epoxide (20)	TWEM (31.4)	No treatment	i	ı	i	1	×	l
Comp. Example-4	=	=	External release treatment (YSR-6209)	1.64	44	0	Colorless trans- parent	0	×
Comp. Example-5	=	2	Reuse of External release treatment (mold used in Comp. Ex. 4)	1	1	1	ı	×	I
Comp. Example-6	=	= .	Use of PP mold	1.64	44	0	Colorless trans- parent	0	×
Comp. Example-7	BPFDGE (17.4)	PEMP (12.2)	No treatment	ļ	1	1	1	×	I
Comp. Example-8	.	=	External release treatment (MS-181)	1.60	37	0	Colorless trans- parent	0	×
Comp. Example-9	=	=	Reuse of External release treatment (mold used in Comp. Ex. 8)	1	1	I		×	1
Comp. Example-10	=	=	Use of PP mold	1.60	37	0	Colorless trans- parent	0	×

What is claimed is:

- comprising forming a mixture containing at least one resin selected from the group consisting of epoxy/episulfide resins having at least two epoxy groups and/or episulfide groups, at least one polythiol compound having at least two functional groups and at least one internal releasing agent; casting and polymerizing the mixture to form said lens.
- 2. The lens of claim 1 wherein the mole ratio of the mercapto groups in at least one polythical compound to sum of epoxy groups and episulfide groups in at least one epoxy resin is from about 0.1 to about 2.0.
- 3. The lens of claim 1 wherein the mole ratio of the mercapto groups in at least one polythiol compound to sum of epoxy groups and episulfide groups in at least one epoxy resin is from about 0.2 to about 1.2.
- 4. The lens of claim 1 comprising casting polymerization in the presence of catalyst.

- 5. The lens of claim 1 comprising casting polymerization adding an optical stabilizer and an ultra violet absorber.
- 6. The lens of claim 1 wherein said internal releasing agent is present in an amount of from about 1 to about 10000 ppm based on the total weight of the sum of said epoxy resins and said polythiol compounds.
- 7. The lens of claim 1 wherein said internal releasing agent is surface active agent.
- 8. The lens of claim 7 wherein said surface active agent is an ionic surface active agent.
- 9. The lens of claim 7 wherein said surface active agent is a nonionic surface active agent.
- 10. The lens of claim 8 wherein said ionic surface active agent is an anionic surface active agent.
 - 11. The lens of claim 8 wherein said

ionic surface active agent is a cationic surface active agent.

- 12. The lens of claim 10 wherein said anionic surface active agent is a phosphoric acid ester base surface active agent.
- 13. The lens of claim 11 wherein said cationic surface active agent is an alkyl quarternary ammonium salt.
- 14. The lens of claim 9 wherein said nonionic surface active agent is a fluorine base nonionic surface active agent having a perfluoroalkyl group and having a hydroxyalkyl group or phosphoric acid ester group.
- 15. The lens of claim 9 wherein said nonionic surface active agent is a silicon base nonionic surface active agent having a dimethylpolysiloxane group and having a hydroxyalkyl group or phosphoric acid ester group.
- 16. The lens of claim 12 wherein said phosphoric acid ester base surface active agent is an acidic phosphoric acid ester base surface

active agent.

- acidic phosphoric acid ester base surface active agent is at least one compound selected from isopropyl acid phosphate, diisopropyl acid phosphate, butyl acid phosphate, dibutyl acid phosphate, octyl acid phosphate, dioctyl acid phosphate, isodecyl acid phosphate, diisodecyl acid phosphate, tridecanol acid phosphate and bis(tridecanol) acid phosphate.
- 18. The lens of claim 13 wherein said alkyl quarternary ammonium salt is at least one salt selected from halogenide, phosphate and sulfate of trimethylcetylammonium, trimethylstearylammonium, dimethylethylcetylammonium, triethyldodecylammonium, trioctylmethylammonium and diethylcyclohexyl-decylammonium.
- 19. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 1.
- 20. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 2.
 - 21. A process for preparing of polysulfide

base resin lens of claim 3.

- 22. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 4.
- 23. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 5.
- 24. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 6.
- 25. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 7.
- 26. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 8.
- 27. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 9.
- 28. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 10.
- 29. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 11.

- 30. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 12.
- 31. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 13.
- 32. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 14.
- 33. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 15.
- 34. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 16.
- 35. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 17.
- 36. A process for preparing of polysulfide base resin lens of claim 18.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/JP89/00454

I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (if several ch	assification symbols apply, indicate all) 6	
According to International Patent Classification (IPC) or to both	National Classification and IPC	
Int. Cl G02B1/04		
II. FIELDS SEARCHED		
Classification System	mentation Searched ?	
	Classification Symbols	
IPC G02B1/04, C08G59/	66, C08G75/04	
Documentation Searched oth	er than Minimum Documentation nts are included in the Fields Searched *	
The state of the s	ms are included in the Fields Searched	
		•
III. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Catagory • Citation of Document, 11 with Indication, where a	poropriate, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13
·		
X JP, A, 59-87126 (Showa 1 Kaisha) 19 May 1984 (19. 05. 84) (Family: none)		1-36
•		
:		
•		
· i		•
•		
•		
•		
<u>:</u>		
i	·	
i		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Special categories of cited documents: 10 A" document defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the phority date and not in conflict with	international filing date or
E" earlier document but published on or after the international	"X" document of particular relevance:	underlying the invention
L" document which may throw doubts on original ac-	inventive step	considered to involve an
citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; if be considered to involve an invention is combined with one or more off complication before observed.	
other means	DOWNSHIP DENIS OUNIORS (O 9 DEI	SON SKIIIED IN the art
P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"&" document member of the same pate	ent family
. CERTIFICATION		
ite of the Actual Completion of the International Search	Date of Malli	
May 30, 1989 (30. 05. 89)	Date of Mailing of this International Sea June 12, 1989 (12	
ernational Searching Authority		. 00. 03)
	Signature of Authorized Officer	.
Japanese Patent Office		